

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2003231804 A

(43) Date of publication of application: 19.08.03

(51) Int. CI

C08L 69/00

C08J 5/00

C08K 5/10

C08K 5/13

C08K 5/1539

C08K 5/3475

C08K 5/524

G02C 7/02

(21) Application number: 2002033942

(22) Date of filing: 12.02.02

(71) Applicant:

MITSUBISHI ENGINEERING

PLASTICS CORP

(72) Inventor:

HIRAI YASUHIRO YAMAZAKI TOSHIHIKO NISHIBAYASHI YUTAKA

(54) POLYCARBONATE RESIN COMPOSITION AND MOLDING COMPOSED OF THE COMPOSITION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an aromatic polycarbonate resin composition having excellent ultraviolet absorbing ability, weather resistance, mold stain resistance, impact resistance, heat resistance, color tone stability and transparency.

SOLUTION: aromatic The polycarbonate composition is obtained by mixing (a) 100 parts wt. of

an aromatic polycarbonate resin with (b) 0.1-1 part wt. of a benzotriazole-based ultraviolet light absorber having ≈350 nm maximum absorption wavelength, (c) 0.003-1 part wt. of a benzofurano-2-one type compound, (d) 0.01-2 parts wt. of a phosphite-based stabilizer and (e) 0.01-2 parts wt. of a phenol-based antioxidant. The aromatic polycarbonate resin has ≈300 ppm terminal hydroxy group concentration and ≤500 ppm remaining monomer amount.

resin COPYRIGHT: (C)2003,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-231804 (P2003-231804A)

(43)公開日 平成15年8月19日(2003.8.19)

									
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ				•	テーマコード(参考)
C08L	69/00			C 0	8 L	69/00			4F071
C08J	5/00	CFD		C 0	8 J	5/00		CFD	4 J O O 2
C08K	5/10			C 0	8 K	5/10			
	5/13					5/13			
	5/1539					5/1539			
			審査請求	未請求	請才	≷項の数10	OL	(全 13 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願2002-33942(P2002-	33942)	(71)	出願。	人 5941375	579		
						三菱工	ンジニ	アリングプラ	スチックス株式
(22)出願日		平成14年2月12日(2002.2	. 12)			会社			
•						東京都	中央区	京橋一丁目1	番1号
•				(72)	発明	者 平井 J	康裕		
						神奈川	県平塚	市東八幡5丁	目6番2号 三
						菱エン	ジニア	リングプラス	チックス株式会
•						社技術·	センタ	一内	
				(74)	代理》	人 1000775	573		
						弁理士	細井	勇	
								•	
				1					最終育に続く

最終負に続く

(54) 【発明の名称】 ポリカーボネート樹脂組成物及びその組成物からなる成形品

(57)【要約】

【目的】紫外線吸収能および耐候性、金型汚染性に優 れ、耐衝撃性、耐熱性、色調安定性、透明性に優れた芳 香族ポリカーボネート樹脂組成物を提供することにあ

【解決手段】 (a) 芳香族ポリカーボネート樹脂100 重量部に対して、(b)最大吸収波長が350nm以上 であるベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤 0. 1~1重 量部、(c)ベンゾフラノー2-オン型化合物0.00 3~1重量部、(d) 亜リン酸エステル系安定剤 0.0 1~2重量部、(e)フェノール系抗酸化剤0.01~ 2重量部、を配合してなる芳香族ポリカーボネート樹脂 組成物であって、上記芳香族ポリカーボネート樹脂が、 その末端水酸基濃度が300ppm以上であり、かつ、残 存モノマー量が500ppm以下のものであることを特徴 とする芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に関する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) 芳香族ポリカーボネート樹脂100 重量部に対して、

- (b)最大吸収波長が350nm以上であるベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤0.1~1重量部、
- (c) ベンゾフラノー2ーオン型化合物0.003~1 重量部、
- (d) 亜リン酸エステル系安定剤 O. O1~2重量部、
- (e) フェノール系抗酸化剤 0. 01~2重量部、を配合してなる芳香族ポリカーボネート樹脂組成物であ 10って、上記芳香族ポリカーボネート樹脂が、その末端水酸基濃度が300ppm以上であり、かつ、残存モノマー量が500ppm以下のものであることを特徴とする芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項2】芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部に対して、さらに(f)離型剤 $0.01\sim1$ 重量部を配合してなることを特徴とする請求項1記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項3】ベンゾフラノー2ーオン型化合物(c)が下記一般式(1)で表される化合物であることを特徴と 20する請求項1または請求項2記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【化1】

$$\bigcap_{m \bowtie} H$$

$$(1)$$

【請求項5】亜リン酸エステル系安定剤(d)が、下記一般式(4)及び/または(5)に示される化合物であることを特徴とする請求項1ないし請求項4記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【化4】

$$P--(OR^1)_3$$
 (4)

(R¹は、置換基を有してもよい炭素数1~20の脂肪 族炭化水素基、脂環族炭化水素基または芳香族炭化水素 基を表す) * (式中、mは0~4、nは0~5の整数であり、X,Y は酸素原子、窒素原子、硫黄原子のいずれか1種または 2種以上を含んでいてもよい炭素数1~18の脂肪族炭 化水素基、脂環族炭化水素基または芳香族炭化水素基を 表し、X,Yは同一であっても異なっていても良い)

2

【請求項4】ベンゾフラノー2ーオン型化合物(c)が、下記構造式(2)もしくは(3)で表される化合物またはそれらの混合物であることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【化2】

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

(3)

【化3】

 $(R^2 \sim R^4$ は、それぞれ置換基を有してもよい炭素数 $1 \sim 20$ の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基または芳香族化水素基を表し、m及びnは、それぞれ $0 \sim 4$ の整数を表す。)

【請求項6】離型剤(f)が、飽和脂肪族カルボン酸エステル化合物であることを特徴とする請求項2ないし請求項5のいずれかに記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項7】芳香族ポリカーボネート樹脂(a)が、芳香 20 族ジヒドロキシ化合物と炭酸ジエステルとのエステル交換反応により製造された芳香族ポリカーボネート樹脂であることを特徴とする請求項1ないし請求項6のいずれかに記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項8】厚み3mmにおける400nmの光線透過率が1%以下であることを特徴とする請求項1ないし請求項7のいずれかに記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項9】請求項1ないし請求項8のいずれか1項に 記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物より製造され 30 たものであることを特徴とする成形品。

【請求項10】請求項1ないし請求項9のいずれか1項に記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物から製造されたものであることを特徴とするメガネレンズ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に関する。詳しくは、紫外線吸収能及び耐候性、耐加水分解性に優れ、耐衝撃性、耐熱性、色調安定性、透明性に優れた芳香族ポリカーボネート樹脂 40組成物、及び該組成物から得られる成形品、特に該組成物から製造されるメガネレンズに関する。

[0002]

【従来の技術】芳香族ポリカーボネート樹脂は、強度、剛性が大きく、また耐摩擦磨耗性が優れているので、例えば、自動車部品、各種精密機械部品等に広く用いられている。しかしながら、芳香族ポリカーボネート樹脂は耐候性が十分ではなく、例えば、屋外での使用または蛍光灯照射下での室内使用においては、製品の変色あるいは強度の低下により使用が制限されていた。このため、

従来から種々の光安定剤が単独であるいは数種組み合わせて用いられており、特にベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤はその効果が比較的大きいので一般に用いられている。

【0003】特開平62-146951号公報及び特開平1-165419号公報にはポリカーボネート樹脂と、メチレンビス(ベンゾトリアゾール)化合物からなる組成物について開示されており、特開平9-291205号公報にはポリカーボネート樹脂とベンゾトリアゾリルフェノール基を2個有する紫外線吸収剤よりなる樹脂組成物より形成されたメガネレンズについて記載されている。しかしながら、用いられている紫外線吸収剤は吸収極大が350nm以下であることから、波長400nm以下における紫外線吸収能が不十分である。また、これらの公報に記載の組成物に関して耐加水分解性についてはなんら言及されていない。

【0004】また、特開平9-263694号公報にはポリカーボネート樹脂組成物に、波長300~345 nmに吸収極大を有する紫外線吸収剤0.05~0.5重量部、及び波長346~400 nmに吸収極大を有する紫外線吸収剤0.01~0.3重量部を添加してなる樹脂組成物より形成されたメガネレンズについて記載されいる。しかしながら、公報の記載特に実施例によると、後者の紫外線吸収剤の添加量が少ないため、この樹脂組成物においても400 nm以下における紫外線吸収能は不十分である。また、この発明においても耐加水分解性についてはなんら言及されていない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、紫外線吸収能及び耐候性、耐加水分解性に優れ、耐衝撃性、耐熱性、色調安定性、透明性に優れた芳香族ポリカーボネート樹脂組成物を提供することにある。

[0006]

50

【課題を解決するための手段】本発明は上記の問題を解決するためになされたものであり、その要旨は、

(1) (a) 芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部に対して、(b) 最大吸収波長が350nm以上であるベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤0.1~1重量部、

(c)ベンゾフラノー2ーオン型化合物0.003~1 重量部、(d) 亜リン酸エステル系安定剤0.01~2 重量部、(e) フェノール系抗酸化剤0.01~2重量 部を配合してなることを芳香族ポリカーボネート樹脂組 成物であって、上記芳香族ポリカーボネート樹脂が、そ の末端水酸基濃度が300ppm以上であり、かつ、残存 モノマー量が500ppm以下のものであることを特徴と する芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に関する。

【0007】また、(2) 本発明は、芳香族ポリカーボネート樹脂 100 重量部に対して、さらに(f) 離型剤を $0.01\sim1$ 重量部を配合してなることを特徴とする上記(1) 記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に

関する。

【0008】(3)ベンゾフラノー2ーオン型化合物 (c)が、下記一般式(1)で表される化合物であるこ とを特徴とする上記(1)または(2)記載の芳香族ポ リカーボネート樹脂組成物に関する。

[0009]

【化6】

(式中、mは0~4、nは0~5の整数であり、X, Y は酸素原子、窒素原子、硫黄原子のいずれか1種または 2種以上を含んでいてもよい炭素数1~18の脂肪族炭 化水素基、脂環族炭化水素基または芳香族炭化水素基を 表し、X, Yは同一であっても異なっていても良い)

*【0010】(4)ベンゾフラノー2ーオン型化合物 (c) が、下記構造式(2) もしくは(3) で表される 化合物またはそれらの混合物であることを特徴とする上 記(1)ないし(3)のいずれかに記載の芳香族ポリカ ーボネート樹脂組成物に関する。

[0011]

【化7】

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

[0012] 【化8】

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

【0013】(5) 亜リン酸エステル系安定剤(d) が、下記一般式(4)及び/または(5)に示される化 合物であることを特徴とする上記(1)ないし(4)の いずれかに記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に 関する。

[0014]

【化9】

$$P-(OR^1)_3$$
 (4)

(R) は、置換基を有してもよい炭素数1~20の脂肪 族炭化水素基、脂環族炭化水素基または芳香族炭化水素 40 基を表す)

[0015]

【化10】

$$(R^2)_m$$
 CH_2
 $P-O-R^4$
 (S)

(R²~R'は、それぞれ置換基を有してもよい炭素数1 ~20の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基または芳 香族化水素基を表し、m及びnは、それぞれ0~4の整 数を表す。)

【0016】(6)離型剤(f)が、飽和脂肪族カルボ ン酸エステル化合物であることを特徴とする上記(2) ないし(5)のいずれかに記載の芳香族ポリカーボネー ト樹脂組成物に関する。

【0017】また(7)芳香族ポリカーボネート樹脂 50 (a)が、芳香族ジヒドロキシ化合物と炭酸ジエステルと

のエステル交換反応により製造された芳香族ポリカーボ ネート樹脂であることを特徴とする上記(1)ないし

(6)のいずれかに記載の芳香族ポリカーボネート樹脂 組成物に関する。

【0018】また(8) 厚み3mmにおける400nmの光線透過率が1%以下であることを特徴とする(1)ないし(7) のいずれかに記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に関する。

【0019】(9) さらに本発明は、上記(1) ないし(8) のいずれか1項に記載の芳香族ポリカーボネート 10 樹脂組成物より製造されたものであることを特徴とする成形品に関する。

【0020】(10) さらには本発明は、上記(1) ないし(9) のいずれか1項に記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物から製造されたものであることを特徴とするメガネレンズに関する。

[0021]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 芳香族ポリカーボネート樹脂(a)は、原料として芳香族 ジヒドロキシ化合物類と炭酸結合を導入し得る化合物類 20 を用い、従来から知られている、界面重縮合法、エステ ル交換法などによって製造することができる。このう ち、エステル交換法によって製造するのが好ましい。

【0022】芳香族ジヒドロキシ化合物としては、具体 的には、例えば、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル)プロパン [=ビスフェノールA]、2,2-ビス (4-ヒドロキシ-3, 5-ジメチルフェニル) プロパ ン、2, 2-ビス(4-ヒドロキシー3, 5-ジエチル フェニル)プロパン、2,2-ビス(4-ヒドロキシー (3, 5-ジフェニル) フェニル) プロパン、2, 2-30 ビス(4-ヒドロキシ-3,5-ジブロモフェニル)プ ロパン、2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ペン タン、2,4'ージヒドロキシージフェニルメタン、ビ ス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、ビス(4-ヒド ロキシー5-ニトロフェニル) メタン、1, 1-ビス (4-ヒドロキシフェニル) エタン、3、3-ビス(4 ーヒドロキシフェニル)ペンタン、1,1ービス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、ビス(4-ヒド ロキシフェニル)スルホン、2,4'ージヒドロキシジ フェニルスルホン、ビス (4-ヒドロキシフェニル)ス 40 ルフィド、4, 4'ージヒドロキシジフェニルエーテ ル、4,4'ージヒドロキシー3,3'ージクロロジフ エニルエーテル、4,4'ージヒドロキシー2,5ージ エトキシジフェニルエーテルなどが例示される。これら の中でも2、2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロ パン [=ビスフェノールA] が好ましい。また、これら の芳香族ジヒドロキシ化合物類は1種でも、必要に応じ て2種以上を併用して共重合体とすることもできる。

【0023】芳香族ポリカーボネート樹脂(a)の製造に 用いられる他方の原料である炭酸結合を導入し得る化合 50 物としては、ホスゲン、炭酸ジエステル類などが挙げられる。炭酸ジエステル類の具体例としては、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、ジー t ーブチルカーボネート、ジフェニルカーボネート、およびジトリルカーボネートなどの置換ジフェニルカーボネートなどが挙げられる。中でも好ましいのは、ジフェニルカーボネート、置換ジフェニルカーボネートであり、特に好ましいのはジフェニルカーボネートである。これらの炭酸ジエステル類は、1種でも2種以上を併用してもよい。

【0024】また、上記のような炭酸結合を導入し得る 化合物と共に、好ましくは50モル%以下、さらに好ま しくは30モル%以下の量でジカルボン酸類、またはジ カルボン酸エステル類を使用することができる。このよ うなジカルボン酸類またはジカルボン酸エステル類とし ては、テレフタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸ジフ エニル、イソフタル酸ジフェニルなどが挙げられる。こ のようなカルボン酸類、またはカルボン酸エステル類を 炭酸ジエステル類と併用した場合には、ポリエステルカ ーボネートが得られる。また、末端停止剤として、pー ターシャリーブチルフェノール、クミルフェノールなど のフェノール類、2-メトキシカルボニルフェニルベン ゾエート、4-クミル安息香酸-(2'-メトキシカル ボニルフェニル) エステル、2-エトキシカルボニルフ エニルベンゾエート、4ー(oーメトキシカルボニルフ ェニル)オキシカルボニル安息香酸-(2'-メトキシ カルボニルフェニル)エステルなどのエステル類を、必 要量使用することができる。

【0025】芳香族ジヒドロキシ化合物類と炭酸ジエステル類との混合比率は、所望の芳香族ポリカーボネート樹脂(a)の分子量と末端水酸基濃度により決められる。芳香族ジヒドロキシ化合物類1モルに対して、炭酸ジエステル類を等モル量以上とするのが一般的であり、好ましくは1.01~1.30モル、特に好ましくは1.01~1.20モルである。

【0026】エステル交換法により芳香族ポリカーボネート樹脂(a)を製造する際には、通常エステル交換触媒が使用される。エステル交換触媒としては特に制限はないが、主としてアルカリ金属化合物類、および/または、アルカリ土類金属化合物類が使用され、これらの触媒は、単独で、または2種以上を組み合わせて使用してもよい。また、助触媒として塩基性ホウ素化合物類、塩基性リン化合物類、塩基性アンモニウム化合物類、またはアミン系化合物類などの塩基性化合物類を併用することもできる。

【0027】アルカリ金属化合物類の具体例としては、 リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウ ムの水酸化物、炭酸水素塩、炭酸塩、酢酸塩、リン酸水 素塩、フェニルリン酸塩などの無機アルカリ金属化合物 類や、ステアリン酸、安息香酸などの有機酸類、メタノ ール、エタノールなどのアルコール類、石炭酸、ビスフ

ェノールAなどのフェノール類との塩などの有機アルカ リ金属化合物類が挙げられる。

【0028】アルカリ土類金属化合物類の具体例として は、ベリリウム、カルシウム、マグネシウム、ストロン チウム、バリウムの水酸化物、炭酸水素塩、炭酸塩、酢 酸塩などの無機アルカリ土類金属化合物類や、有機酸 類、アルコール類、フェノール類との塩などの有機アル カリ土類金属化合物類などが挙げられる。

【0029】塩基性ホウ素化合物類の具体例としては、 テトラメチルホウ素、テトラエチルホウ素、テトラプロ 10 ピルホウ素、テトラブチルホウ素、トリメチルエチルホ ウ素トリメチルベンジルホウ素、トリメチルフェニルホ ウ素、トリエチルメチルホウ素、トリエチルベンジルホ ウ素、トリエチルフェニルホウ素、トリブチルベンジル ホウ素、トリブチルフェニルホウ素、テトラフェニルホ ウ素、ベンジルトリフェニルホウ素、メチルトリフェニ ルホウ素、ブチルトリフェニルホウ素、等のナトリウム 塩、カリウム塩、リチウム塩、カルシウム塩、マグネシ ウム塩、バリウム塩、またはストロンチウム塩などが挙 げられる。

【0030】塩基性リン化合物類の具体例としては、ト リエチルホスフィン、トリーnープロピルホスフィン、 トリイソプロピルホスフィン、トリーnーブチルホスフ ィン、トリフェニルホスフィン、トリブチルホスフィ ン、または四級ホスホニウム塩などが挙げられる。

【0031】塩基性アンモニウム化合物類の具体例とし ては、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラ エチルアンモニウムヒドロキシド、テトラプロピルアン モニウムヒドロキシド、テトラブチルアンモニウムヒド ロキシド、トリメチルエチルアンモニウムヒドロキシ ド、トリメチルベンジルアンモニウムヒドロキシド、ト リメチルフェニルアンモニウムヒドロキシド、トリエチ ルメチルアンモニウムヒドロキシド、トリエチルベンジ ルアンモニウムヒドロキシド、トリエチルフェニルアン モニウムヒドロキシド、トリブチルベンジルアンモニウ ムヒドロキシド、トリブチルフェニルアンモニウムヒド ロキシド、テトラフェニルアンモニウムヒドロキシド、 ベンジルトリフェニルアンモニウムヒドロキシド、メチ ルトリフェニルアンモニウムヒドロキシド、ブチルトリ フェニルアンモニウムヒドロキシドなどが挙げられる。 【0032】アミン系化合物類の具体例としては、4-アミノピリジン、2-アミノピリジン、N, N-ジメチ ルー4ーアミノピリジン、4ージエチルアミノピリジ ン、2-ヒドロキシピリジン、2-メトキシピリジン、 4-メトキシピリジン、2-ジメチルアミノイミダゾー ル、2-メトキシイミダゾール、イミダゾール、2-メ ルカプトイミダゾール、2-メチルイミダゾール、アミ ノキノリンなどが挙げられる。

【0033】これらエステル交換触媒のうち、実用的に はアルカリ金属化合物類、塩基性アンモニウム化合物 50 類、塩基性リン化合物類が望ましく、特にアルカリ金属 化合物類が好ましい。

10

【0034】触媒の使用量は、芳香族ジヒドロキシ化合 物類1モルに対して、1×10⁻ ° ~1×10⁻ ° モル の範囲で選ぶことができる。特にアルカリ金属化合物 類、アルカリ土類化合物類では、通常は芳香族ジヒドロ キシ化合物類1モルに対して1×10⁻°~1×10 - ' モル、好ましくは1×10⁻⁸~1×10⁻⁵モル の範囲で選ばれる。塩基性ホウ素化合物類、塩基性リン 化合物類、塩基性アンモニウム化合物類またはアミン系 化合物類などの塩基性化合物類では、芳香族ジヒドロキ シ化合物類1モルに対して1×10⁻ % ~1×10⁻ 3 モル、好ましくは1×10⁻¹~1×10⁻⁴ モルの節 囲で選ばれる。

【0035】触媒量が上記範囲より少ない場合には、所 定の分子量、所望の末端水酸基量を有する芳香族ポリカ ーボネート樹脂(a)を製造するのに必要な重合活性が得 られず、上記範囲より多い場合は、後記する環状オリゴ マー量の増加、ポリマー色調の悪化、耐熱性の低下、耐 加水分解性の低下や、ゲルの発生による異物量が増大す るなど、好ましくない。

【0036】芳香族ポリカーボネート樹脂(a)の分子量 は、粘度平均分子量で20,000~50,000の範 囲が好ましい。20,000未満では芳香族ポリカーボ ネート樹脂の機械的強度さらにはレンズ成形品の耐衝撃 性が低下するため、好ましくない。また、50,000 以上では溶融粘度が高くなり過ぎて成形性に問題があ る。上記範囲で好ましくは20,000~40,000 であり、中でも特に好ましくは21,000~30,0 00である。なお、本発明において粘度平均分子量(M v)とは、塩化メチレンを溶媒とし、ウベローデ粘度計 によって25℃の温度で極限粘度 [n]を測定し、次 式、すなわち、

 $[\eta] = 1.23 \times 10^{-4} \times (Mv)^{0.83}$ 、により算 出した。

【0037】 芳香族ポリカーボネート樹脂(a)の末端水 酸基濃度は、300~2,000ppmの範囲が好まし く、さらに好ましくは350~1000ppm、特に好ま しくは400~800ppmの範囲である。

【0038】本発明において芳香族ポリカーボネート樹 脂(a)の末端水酸基濃度(ppm)は、Makromol.Chem.88 21 5(1965)に記載されている四塩化チタンと酢酸を用いる 比色定量法により測定することができ、ビスフェノール Aを基準物質として次式、すなわち、末端水酸基濃度(p pm)=芳香族ポリカーボネート樹脂中の末端水酸基量 $(\mu \text{ mol}/g) \times 17$ 、で算出することができる。

【0039】上記の特性を有する芳香族ポリカーボネー ト樹脂(a)は、前記芳香族ジヒドロキシ化合物類と、前 記炭酸結合を導入し得る化合物類とを選び、通常は上記 エステル交換触媒を使用して製造される。エステル交換

40

反応を行う際には、140~320℃の温度範囲、圧力

は常圧または減圧が選ばれ、芳香族ヒドロキシ化合物な どの副生成物を除去しながら、溶融重縮合反応を行う方 法が挙げられる。 【0040】溶融重縮合反応は、バッチ式または連続的 に行うことができるが、製品の安定性などの観点から連

続式で行うことが好ましい。反応は通常、温度、圧力条 件を変化させた2段以上の多段工程で行われる。各段階 の反応温度は、上記範囲内で反応生成物が溶融状態にあ れば特に制限はなく、また反応時間は、反応の進行の程 10 度により適宜定められるが、0.1~10時間で選ばれ る。 具体的には、第1段目の反応は常圧または減圧下 で、温度は140~260℃、好ましくは180~24 0℃で、反応時間は0.1~5時間、好ましくは0.5 ~3時間反応させる。ついで反応系の減圧度を上げなが ら反応温度を高め、最終的には2mmHg以下の減圧下、2 40~320℃の温度で重縮合反応を行う。

【0041】溶融重縮合反応を行う装置には特に制限が なく、槽型、管型または塔型のいずれの型式であっても よく、各種の撹拌翼を備えた竪型重合槽、横型1軸撹拌 20 翼型または横型2軸撹拌翼型などの重合槽を使用するこ とができる。溶融重縮合反応中の雰囲気は特に制限はな いが、反応生成物の品質の観点から、窒素ガスなどの不 活性ガス存在下または減圧下で行うのが好ましい。

【0042】溶融重縮合反応終了後、製造された芳香族 ポリカーボネート樹脂は通常、ペレットとして回収され るが、その際、生成した芳香族ポリカーボネート樹脂中 に残存するモノマーや副生物などの低分子量成分を除去 するために、ベント式押出機で溶融混練しつつ強制的に 揮発させて除去できる。芳香族ポリカーボネート樹脂 (a)中の残存モノマーとしては、芳香族ジヒドロキシ化 合物類、炭酸ジエステル類、これらの重縮合反応時の副 生物および末端停止剤であるものモノヒドロキシ化合物 類が挙げられる。

【0043】 芳香族ポリカーボネート樹脂(a)中に含ま れるこれら残存モノマーは、合計量を500ppm以下と する。残存モノマーが500ppmを越えると、接合部の 接着強度が低下するので好ましくない。芳香族ポリカー ボネート樹脂(a)中の残存モノマー量は、300ppm以 下がより好ましい。さらに、各残存モノマーの残存量と 40 しては、モノヒドロキシ化合物類が100ppm以下、芳 香族ジヒドロキシ化合物類が100ppm以下、炭酸ジエ ステル類が300ppm以下であると、さらに好ましい。

【0044】溶融重縮合を行う際に触媒、特にアルカリ 金属化合物類触媒を用いた場合には、エステル交換法ポ リカーボネート中の残存触媒を、失活剤によって中和す るのが好ましい。残存触媒を中和する失活剤としては、 例えばイオウ含有酸性化合物類またはそれより形成され る誘導体類が挙げられる。失活剤の使用量は、触媒のア ルカリ金属化合物類の量に対して0.5~10当量の範 50 囲が好ましく、特に好ましくは1~5当量の範囲であ る。生成する芳香族ポリカーボネート樹脂を基準とする 場合には、通常1~100ppmの範囲であり、特に好ま しくは1~20ppmである。

12

【0045】イオウ含有酸性化合物類またはそれより形 成される誘導体類の例としては、スルホン酸、スルフィ ン酸、硫酸またはそれらのエステル類であり、具体的に はジメチル硫酸、ジエチル硫酸、p-トルエンスルホン 酸、そのメチル、エチル、ブチル、オクチルおよびフェ ニルエステル類、ベンゼンスルホン酸、そのメチル、エ チル、ブチル、オクチル、フェニルおよびドデシルエス テル類、ベンゼンスルフィン酸、トルエンスルフィン 酸、ナフタレンスルホン酸などが挙げられる。これらの 化合物のうち、pートルエンスルホン酸のエステルまた はベンゼンスルホン酸のエステル類が好ましく、これら の化合物は1種でも2種以上を併用することもできる。 【0046】上記失活剤を生成した芳香族ポリカーボネ

ート樹脂(a)へ添加する方法は、特に限定されるもので はなく、従来から知られている方法によることができ る。例えば、上記の失活剤を直接または希釈剤で希釈し て、溶融または固体状態にある生成した芳香族ポリカー ボネート樹脂に添加し、混合する方法によることができ る。具体的には重縮合反応器、反応器からの樹脂移送ラ イン、または押出機で溶融混練する際のいずれかで失活 剤を添加することにより、芳香族ポリカーボネート樹脂 に混合することができる。また、ミキサーなどで芳香族 ポリカーボネート樹脂のペレット、フレーク、粉末など に失活剤を混合した後、押出機によって溶融混練する方 法であってもよい。

【0047】なお、本発明においては、ポリカーボネー 30 トに紫外線吸収剤、離型剤、着色剤等の各種添加剤を配 合することもでき、ポリカーボネートの製造途中、又は ペレット製造の前にこれらの添加剤を添加する場合もあ り、一般にそれらの添加剤を含んだものを「ポリカーボ ネート」と称する場合があるが、本発明で規定する上記 関係式の値は、これらの添加剤を全く含まないポリカー ボネートについて求められるものである。

【0048】本発明に用いられる紫外線吸収剤(b) は、ベンゾトリアゾール構造を有し、最大吸収波長が3 50 n m以上である紫外線吸収剤が使用される。このよ うなベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤としては、具体 的には、2~ [5-クロロ(2H) -ベンゾトリアゾー ル) フェノール及び2, 4-ジ-tert-ブチルー6 - (5-クロロベンゾトリアゾール) - 2-イル) フェ ノールが挙げられる。

【0049】上記の紫外線吸収剤に加えて、さらにその 他の紫外線吸収剤を併用することができる。その他の紫 外線吸収剤としては、ベンゾフェノン系,、サリチル酸 フェニル系、ヒンダードアミン系等が挙げられる。ベン

20

30

14

ソフェノン系紫外線吸収剤としては、2,4-ジヒドロ キシーベンソフェノン、2-ヒドロキシー4-メトキシ ーベンゾフェノン、2ーヒドロキシー4ーnーオクトキ シーベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-ドデシロキ シーベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-オクタデシ ロキシーベンゾフェノン、2、2'ージヒドロキシー4 ーメトキシーベンゾフェノン、2,2'ージヒドロキシ -4.4'-ジメトキシーベンゾフェノン、2,2', 4, 4'ーテトラヒドロキシーベンゾフェノン等が挙げ られる。

【0050】サリチル酸フェニル系紫外線吸収剤として は、フェニルサルチレート、2,4-ジターシャリーブ チルフェニルー3,5-ジターシャリーブチルー4-ヒ ドロキシベンゾエート等が挙げられる。ヒンダードフェ ノール系紫外線吸収剤としては、ビス(2,2,6,6 ーテトラメチルピペリジン-4-イル) セバケート等が 挙げられる。

【0051】上記の他に、最大吸収波長が350nm以 下のベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤も併用すること ができる。

【0052】紫外線吸収剤としては、上記以外に紫外線 の保有するエネルギーを、分子内で振動エネルギーに変 換し、その振動エネルギーを、熱エネルギー等として放 出する機能を有する化合物が含まれる。さらに、酸化防 止剤あるいは着色剤等との併用で効果を発現するもの、 あるいはクエンチャーと呼ばれる、光エネルギー変換剤 的に作用する光安定剤等も併用することができる。

【0053】本発明に用いられる紫外線吸収剤(b)の 配合量は、芳香族ポリカーボネート樹脂(a)100重 量部に対し、0.1~1重量部であり、好ましくは0. 15~0.8重量部、さらに好ましくは0.2~0.6 重量部である。紫外線吸収剤の配合量が 0. 1 重量部よ り少ない場合には、紫外線吸収剤の効果として不十分で あり、一方、1重量部を超える量を添加しても、本発明 の目的とする組成物としての改良効果は見られない。

【0054】本発明におけるベンゾフラノー2ーオン型*

*化合物(c)は、下記一般式(1)に示される構造を有 する化合物である。

[0055]

【化11】

$$H$$
 M_n
 M_n
 M_n
 M_n

(式中、mは0~4、nは0~5の整数であり、X, Y は酸素原子、窒素原子、硫黄原子のいずれか1種または 2種以上を含んでいてもよい、炭素数1~18の脂肪族 炭化水素基、脂環族炭化水素基または芳香族炭化水素基 を表し、X,Yは同一であっても異なっていても良い) 【0056】上記のベンゾフラノー2ーオン型化合物 は、ポリマー中のアルキルラジカルを捕捉し、自動酸化 反応を抑制する効果を有しており、かつ、成形加工時に 黄変を抑える効果を持つ特殊な安定剤である。好ましく は下記構造式(2)または(3)で表される化合物、ま たはそれらの混合物である。

[0057]

【化12】

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

[0058] 【化13】

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

【0059】上記ベンゾフラノー2ーオン型化合物はチ バ・スペシャリティー・ケミカルズ社から商品名「HP -136」として市販されている。これらのベンゾフラ ノー2ーオン型化合物は、通常はリン系安定剤及びフェ 50 シャリティー・ケミカルズ社から商品名「イルガノック

ノール系抗酸化剤と併用して用いることにより、大幅な 加工安定性を改善することができる。リン系安定剤及び フェノール系抗酸化剤との併用品としては、チバ・スペ スHP2215」、「イルガノックスHP2225」、「イルガノックスHP2251」、「イルガノックスH P2921」、および「イルガノックスHP2411」 等として市販されており、容易に入手することができ る。

【0060】本発明において、ベンゾフラノー2ーオン型化合物(c)の配合量は、芳香族ポリカーボネート樹脂(a)100重量部に対して、0.003~1重量部であり、好ましくは0.005~0.5重量部が好ましく、さらに好ましくは0.007~0.1重量部である。0.003重量部より少ない場合には、安定剤としての効果が不十分であり、1重量部を越えた量を添加しても、それ以上の安定剤としての効果は得られない。

【0061】本発明に用いられる亜リン酸エステル系安定剤(d)(以下、単に「リン系安定剤」ということがある)としては、種々のものが使用されるが、耐加水分解性が要求される組成物については、ペンタエリスリトール構造を有する亜リン酸エステル系安定剤の使用は、プレッシャークッカー試験(120℃,100%RH,5hr)後に、成形品が白濁する場合があり好ましくな20い。本発明において用いられる亜リン酸エステル系安定剤(d)としては、下記一般式(4)および/または(5)で示される亜リン酸エステル系安定剤が好ましい。

【0062】 【化14】

$$P-(OR^1)_3$$
 (4)

(R'は、置換基を有してもよい炭素数 1 ~ 2 0 の脂肪 族炭化水素基、脂環族炭化水素基、または芳香族炭化水 30 素基を表す)

[0063]

【化15】

 $(R^2 \sim R^3$ は、それぞれ置換基を有してもよい炭素数 $1 \sim 20$ の脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、または芳香族炭化水素基を表し、m及Un は、それぞれ $0 \sim 4$ の整数を表す。)

上記の式において R^1 、および $R^2 \sim R^4$ で示される基としては、それぞれ例えば、炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル

基、シクロアルキル基等の脂肪族炭化水素基またはフェニル基等の芳香族炭化水素基が好ましい。また、これらの基はヒドロシル基等の置換基で置換されていてもよい。

16

【0064】上記一般式(4)または(5)の構造を有する亜リン酸エステル系安定剤としては、具体的には、例えば、トリス(ノニルフェニル)ホスファイト、トリフェニルホスファイト、トリス(2,4ージーtertーブチルフェニル)ホスファイト、2,2ーメチレンビス(4,6ージーtertーブチルフェニル)ホスファイト、トリス(ブチルフェニル)ホスファイト及びトリス(ヒドロキシフェニル)ホスファイトなどが挙げられる。これらのうち、トリス(2,4ージーtertーブチルフェニル)ホスファイト、2,2ーメチレンビス(4,6ージーtertーブチルフェニル)オクチルホスファイトが好ましい。

【0065】本発明において、亜リン酸エステル系安定剤(c)の配合量としては、芳香族ポリカーボネート樹脂(a)100重量部に対して0.01~2重量部である。配合量が0.01重量部より少ないと、安定剤としての効果が不十分であり、一方、2重量部を超えて添加してもそれ以上の安定剤としての効果は得られない。亜リン酸エステル系安定剤の配合量は0.02~1重量部が好ましい。

【0066】上記リン系安定剤を用いることで耐候性、耐衝撃性、透明性、色調安定性、に優れたポリカーボネート樹脂組成物が得られるが、このリン系安定剤に加えて、以下のフェノール系抗酸化剤を配合することにより、さらなる耐候性、色調安定性が優れたポリカーボネート樹脂組成物を得ることができる。

【0067】本発明におけるフェノール系抗酸化剤 (e) としては, 特に制限はないがヒンダードフェノー ル系が好適に用いられる。代表的な例としてはペンタエ リスリトールテトラキス [3-(3, 5-ジーtert ーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオネー ト]、オクタデシルー3-(3, 5-ジ-tert-ブ チルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオネート、チオ ジエチレンビス[3-(3,5-ジーtert-ブチル 40 - 4 - ヒドロキシフェニル) プロピオネート]、N,N' - n + y - 1, 6 - y + y + z = 3 - (3, 5 - 1)ジーtertーブチルー4ーヒドロキシフェニルプロピ オナミド]、2,4-ジメチル-6-(1-メチルペン タデシル)フェノール、ジエチル[[3,5ービス (1, 1-ジメチルエチル) -4-ヒドロキシフェニ ル] メチル] ホスフォエート、3, 3', 3", 5, 5', 5"-ヘキサーtert-ブチルーa, a', a"-(メシチレンー2, 4, 6ートリイル) トリーpークレ ゾール、4,6ービス(オクチルチオメチル)-0-ク

レゾール、エチレンビス(オキシエチレン)ビス〔3-

18

(5-tert-ブチルー4-ヒドロキシ-m-トリ ル)プロピオネート]、ヘキサメチレンビス「3-(3, 5-ジーtert-ブチルー4-ヒドロキシフェ ニル)プロピオネート、1,3,5ートリス(3,5-ジーtertーブチルー4ーヒドロキシベンジル)ー 1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6 (1H, 3H, 5 H) -トリオン、2, 6-ジ-tert-ブチル-4-(4, 6-ビス(オクチルチオ)-1, 3, 5-トリア ジンー2ーイルアミノ)フェノール等が挙げられる。上 記のうちで、特にペンタエリスリトールテトラキス [3 10] $-(3, 5-\tilde{y}-tert-\tilde{y}+\tilde{y}-4-t)$ ェニル)プロピオネート]、オクタデシルー3ー(3, 5-ジーtertーブチルー4-ヒドロキシフェニル) プロピオネートが好ましい。これらのフェノール系抗酸 化剤は、チバ・スペシャルテイ・ケミカルズ社より商品 名「イルガノックス1010」及び「イルガノックス1 076」として市販されており、容易に入手することが できる。

【0068】上記フェノール系抗酸化剤(d)の配合量としては、(a) 芳香族ポリカーボネート樹脂100重 20量部に対して0.01~2重量部である。配合量が0.01重量部より少ない場合には、抗酸化剤としての効果が不十分であり、一方2重量部を超えて添加してもそれ以上の抗酸化剤としての効果は得られない。フェノール系抗酸化剤の配合量は0.02~1重量部が好ましい。【0069】本発明に用いられる離型剤(f)は、脂肪族カルボン酸、脂肪族カルボン酸エステル、数平均分子量200~15000の脂肪族炭化水素化合物、ポリシロキサン系シリコーンオイルから選ばれた少なくとも1

種の化合物である。これらの中で、脂肪族カルボン酸、

脂肪族カルボン酸エステルから選ばれた少なくとも1種

が好ましく、脂肪族カルボン酸エステル、中でも飽和脂

肪族カルボン酸エステルが特に好ましく用いられる。 【0070】脂肪族カルボン酸としては、飽和又は不飽和の脂肪族モノカルボン酸、ジカルボン酸又はトリカルボン酸を挙げることができる。ここで脂肪族カルボン酸は、脂環式カルボン酸も包含する。このうち好ましい脂肪族カルボン酸は、炭素数6~36のモノ又はジカルボン酸であり、炭素数6~36の脂肪族飽和モノカルボン酸がさらに好ましい。このような脂肪族カルボン酸の具40体例としては、パルミチン酸、ステアリン酸、吉草酸、カプロン酸、カプリン酸、ラウリン酸、アラキン酸、ベヘン酸、リグノセリン酸、セロチン酸、メリシン酸、テ

【0071】脂肪族カルボン酸エステルを構成する脂肪族カルボン酸成分としては、前記脂肪族カルボン酸と同じものが使用できる。一方、脂肪族カルボン酸エステルを構成するアルコール成分としては、飽和又は不飽和の1価アルコール、飽和又は不飽和の多価アルコール等を50

トラトリアコンタン酸、モンタン酸、グルタル酸、アジ

ピン酸、アゼライン酸等を挙げることができる。

挙げることができる。これらのアルコールは、フッ素原 子、アリール基等の置換基を有していてもよい。これら のアルコールのうち、炭素数30以下の1価又は多価の 飽和アルコールが好ましく、さらに炭素数30以下の脂 肪族飽和1価アルコール又は多価アルコールが好まし い。ここで脂肪族アルコールは、脂環式アルコールも包 含する。これらのアルコールの具体例としては、オクタ ノール、デカノール、ドデカノール、ステアリルアルコ ール、ベヘニルアルコール、エチレングリコール、ジエ チレングリコール、グリセリン、ペンタエリスリトー ル、2、2-ジヒドロキシペルフルオロプロパノール、 ネオペンチレングリコール、ジトリメチロールプロパ ン、ジペンタエリスリトール等を挙げることができる。 これらの脂肪族カルボン酸エステルは、不純物として脂 肪族カルボン酸及び/又はアルコールを含有していても よく、複数の化合物の混合物であってもよい。

【0072】脂肪族カルボン酸エステルの具体例としては、蜜ロウ(ミリシルパルミテートを主成分とする混合物)、ステアリン酸ステアリル、ベヘン酸ベヘニル、ベヘン酸オクチルドデシル、グリセリンモノパルミテート、グリセリン・リステアレート、グリセリンシステアレート、グリセリントリステアレート、ペンタエリスリトールモノパルミテート、ペンタエリスリトールジステアレート、ペンタエリスリトールデトラステアレートを挙げることができる。特に好ましいのはステアリン酸ステアリル、ベヘン酸ベヘニルである。

【0073】該離型剤の配合量は、芳香族ポリカーボネート樹脂100重量部に対して0.01~1重量部であり、好ましくは0.03~0.5重量部である。1重量部を超えると耐加水分解性の低下、射出成形時の金型汚染等の虞があり、0.01重量部より少ないと離型不良を起こし易い。該離型剤は1種でも使用可能であるが、複数併用して使用することもできる。

【0074】本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物の製造方法としては、特に制限はなく、例えば、

(a) 芳香族ポリカーボネート樹脂、(b) 紫外線吸収剤、(c) ベンゾフラノー2ーオン型化合物、(d) 亜リン酸エステル系安定剤、および(e) フェノール系抗酸化剤、さらに必要に応じて(f) 離型剤を一括溶融混練する方法、あるいは(a) 芳香族ポリカーボネート樹脂、(b) 紫外線吸収剤、(d) 亜リン酸エステル系安定剤を予め混練後、(c) ベンゾフラノー2ーオン型化合物(e) フェノール系抗酸化剤、さらに必要に応じて(f) 離型剤を配合し、溶融混練する方法などが挙げられる。

【0075】本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物には、上記の(a)~(f)の成分の他に、芳香族ポリカーボネート樹脂に通常添加されるそれ自体公知の顔

30

料、染料などの添加剤を適宜配合することができる。 【0076】

19

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の実施例に限定されるものではない。なお、ポリカーボネート以外の原材料と樹脂組成物試験方法を次に示す。

【0077】(1) 紫外線吸収剤-1:2-[5-クロロ(2H) -ベンゾトリアゾール-2-イル] 4-メチル-6-tert-ブチルフェノール(最大吸収波長:353nm)

(2) 紫外線吸収剤-2:2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-(1,1,3,3,-テトラメチルブチル)フェノール(最大吸収波長:343nm)【0078】(3)ベンゾフラノ-2-オン型化合物:下記構造式(2)で表される化合物、商品名:HP-136、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製

[0079]

【化16】

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

【0080】(4) リン系安定剤-1:トリス(2, 4 -ジーtert-ブチルフェニル) ホスファイト (5) リン系安定剤-2:2, 2-メチレンビス(4, 6-ジーtert-ブチルフェニル) オクチルホスファ イト

【0081】(6) フェノール系抗酸化剤:ペンタエリスリトールテトラキス[3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、商品名:IRGANOX1010,チバ・スペシャルテイ・ケミカルズ(株)製

【 0 0 8 2】 (7)離型剤-1:ステアリン酸ステアリ ル

(8) 離型剤-2: ベヘン酸ベヘニル

【0083】なお、試験片の物性評価は次に記載のように行った。

【0084】(A)紫外線吸収剤の最大吸収波長:紫外線吸収剤をトルエンに溶解し、分光光度計UV-3100PC((株)島津製作所)を用いて、JIS-K7361に準拠して測定した。

【0085】(B)初期黄変度(YI):日本製鋼所製 J-50EP成形機を用いて厚さ3mmのプレートを2 90℃で通常成形した。成形品(プレート)について分 50 光式色彩計SE-2000(日本電色工業(株)製)で 測定した。

20

【0086】(C)滞留成形後の Δ E, Δ YI:日本製鋼所製J-50EP成形機を用いて320C-10分サイクルで3mmのプレートを成形し、最初の1ショット目と7ショット目の色相を分光式色彩計SE-2000を用いて測定し、 Δ E, Δ YIを求めた。

【0087】(D) UVカット波長:日本製鋼所製」-50EP成形機を用いて厚さ3mmのプレートを成形し、この成形品(プレート)を用いて分光光度計UV-3100PC((株)島津製作所)を用いて、JIS-K7361 に準拠して測定した。

【0088】(E) 耐加水分解性: 厚さ3 mmの成形品(プレート)を用い、プレッシャークッカー試験(120 ℃、RH100%、5 hr)を行い、試験前後の曇り度合いを評価した。

〇:試験後プレートは白濁せず。×:試験後プレートは 白濁した。

【0089】(F)メガネレンズの耐衝撃試験:金型で 20 厚さ2mmのメガネレンズを成形し、落球衝撃試験(直 径6cm、重さ1.05kgの鉄球を1.8mの高さか ら落下させる方法)を行った。

○: 落球衝撃試験で割れず。×: 落球衝撃試験で割れ発生。

【0090】(G)ポリカーボネートの粘度平均分子量(Mv):ウベローデ粘度計を用いて、塩化メチレン中25 Cの極限粘度 $[\eta]$ を測定し、以下の式より粘度平均分子量(Mv)を求めた。

 $[\eta] = 1. 23 \times 10^{-4} \times (Mv)^{0.83}$

【0091】(H) 光線透過率:日本製鋼所製 J-50 EP成形機を用いて厚さ3mmのプレートを成形し、この成形品(プレート)を用いて分光光度計UV-3100PC((株) 島津製作所)を用いて、JIS-K7361 に準拠して測定した。

【0092】(I) ポリカーボネートの末端OH基含有量:四塩化チタン/酢酸法 (Makromol. Chem. 88 215 (1965) に記載の方法) により比色定量を行った。測定値は、ポリカーボネート重量に対する末端OH基の重量をppm単位で表示した。

40 【0093】(J) 残留モノマー量:カラムにWaters社 製の μ -Bondersphereを使用し、溶媒としてアセトニト リルと酢酸水との混合液を使用し、UV検出器を備えた 高速液体クロマトグラフによって測定した。

【0094】参考例(芳香族ポリカーボネート樹脂の製造)

ビスフェノールAとジフェニルカーボネートとを原料とし、エステル交換触媒として炭酸セシウムをビスフェノールA1モルに対して0.5×10⁻⁶モル添加して、エステル交換反応を行い、末端水酸基濃度とモノマー残留量の異なる3種類の芳香族ポリカーボネート樹脂(P

22

C-1、PC-2、PC-3)を製造した。得られた3種類の芳香族ポリカーボネート樹脂が溶融状態にある間に、パラトルエンスルフォン酸ブチル(失活剤)を5ppm添加した後、押出機で混練してペレット化した。

* 樹脂 (PC-1、PC-2) と、比較例に使用した芳香 族ポリカーボネート樹脂 (PC-3) についての分析値 を表1に示す。

[0096]

【0095】得られた3種類の芳香族ポリカーボネート*

【表 1】

	粘度平均	末端水酸基	残留モノマー量(ppm)					
	分子盘 (Mv)	濃度(ppm)	モノヒト ロキシ 化合物	炭酸ジエステル	芳香族th* ロキシ 化合物			
PC-1 PC-2	22000 22000	440 · 790	58 51	223 . 141	24 82			
PC-3	22000	580	116	418	93			

【0097】実施例1~7,比較例1~4

表2、表3に示す配合処方で、原料を秤量しタンブラーにて20分混合後、40mm単軸押出機にてシリンダー温度290℃でペレット化し、射出成形機にて、シリンダー温度290℃にて3mm厚プレートを通常成形及び※

※10分間320℃で滞留させて成形し、耐候性及び黄変度を評価した。またメガネレンズの耐衝撃試験を行った。評価結果を表2および表3に示す。

[0098]

【表2】

	单位	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例
		1	2	3	4	5	6	7
PC-1	重量部	100	-	100	-	100	100	100
PC-2		-	100	_	100	_	-	_
紫外線吸収剤-1		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
ベンプフラノー 2・オン型化合物		0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.03
リン系安定剤ー1		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06
リン系安定剤 2		-	-	_	-	0.03	-	-
フェノール系抗酸化剤		0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.12
離型剂-1			_	0.2	0.2	_	-	0.2
離型剤−2	İ	-	_	- '	-	_	0.2	-
紫外線吸収剂最大吸収液長	n m	353	353	353	353	353	353	353
初朔竹值	_	5.6	5.6	5.7	6.7	5.6	5.7	5.1
820℃滯留成形 (3 mm 厚)								
ΔE		0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
ΔΥΙ		1.3	1.2	1.0	1.0	1.2	· 1.1	1.2
UV カット波長(3mm 厚)	nm	400	400	400	400	400	400	400
400nm での光線透過率	%	1%	1 %	1%	1%	1 %	1%	1%
(3mm 厚)		以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
耐加水分解性		0	0	0	0	0	0	0
メガネレンズの耐衝撃性		0	0	0	0	0	ာ	C

[0099]

【表3】

	単位	比較例	比較例	比較例	比較例
	<u> </u>	1 .	2	. 3	4
PC-1	重量部	-	-	100	100
PC-3	l .	100	100	_	-
紫外線吸収剤-1		0.4	0.4	0.4	-
紫外線吸収剤-2		_		_	0.4
ヘングフラノ・2・お型化合物		0.015	0.015	_	0.015
リン系安定剤ー 1		0.03	0.03	0.03	0.03
フェノール系抗酸化剤		0.06	0.06	0.06	0.06
雕型剤-1			0.2	_	-
紫外線吸収剤最大波長	nm	353	353	353	343
初期 YI 値		6.3	6.4	5.7	2.2
320℃滞留成形 (3mm 厚)					
ΔE		1.2	1.2	1.0	0.8
ΔΥΙ		2.0	2.0	1.8	1.4
UV カット波長(8mm 厚)	n m·	376	378	376	376
400nm での光線透過率	%	1 %	1 %	1 %	50%
(3mm 厚)		以下	以下	以下	
耐加水分解性		0	0	×	0
カガネレンズの耐衝撃性		×	×	0	0

[0100]

成物は、紫外線吸収能及び耐候性、金型汚染性、耐加水

【発明の効果】本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂組 50 分解性に優れ、耐衝撃性、耐熱性、色調安定性、透明性

に優れており、特にメガネレンズ用途等に極めて有用で* * ある。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

C08K

テーマコード(参考)

C 0 8 K 5/3475

5/524

5/524

5/3475

G 0 2 C 7/02

G 0 2 C 7/02

(72)発明者 山崎 俊彦

神奈川県平塚市東八幡5丁目6番2号 三 菱エンジニアリングプラスチックス株式会 社技術センター内 ※ ※(72)発明者 西林 豊

神奈川県平塚市東八幡5丁目6番2号 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会

社技術センター内

Fターム(参考) 4F071 AA50 AA81 AC11 AC15 AC19

AE05 AF02 AF30 AF45 AF57

BA01 BB05 BC07

4J002 CG011 CG021 EJ068 EL079

EU176 EW067 FD037 FD056

FD078 FD209 GP01

20